國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班

碩士論文

氧化鑭, 氧化鐠及氧化鉿介電層特性之研究

The Study of Electrical Properties on La₂O_{3,}

Pr₂O₃ and HfO₂ Gate Dielectrics

研 究 生: 林盈彰

指導教授:黃調元 博士

簡昭欣 博士

中華民國九十三年六月

氧化鑭, 氧化鐠及氧化鉿介電層特性之研究

The Study of Electrical Properties on $La_2O_{3,}$ Pr_2O_3 and HfO_2 Gate Dielectrics

研究生: 林盈彰 Student: Ying-Chang Lin

指導教授:黃調元 博士 Advisor: Dr. Tiao-Yuan Huang

簡昭欣 博士 Dr. Chao-Hsin Chien

國 立 交 通 大 學電子工程學系 電子研究所碩士班碩 士 論 文

Submitted to Institute of Electronics

College of Electrical Engineering and Computer Science

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Science

in

Electronic Engineering

June 2004

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十三年六月